PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11104942 A

(43) Date of publication of application: 20.04.99

(51) Int. CI

B24B 9/00

H01L 21/304

H01L 21/304

(21) Application number: 09285988

(71) Applicant:

SPEEDFAM CO LTD

(22) Date of filing: 02.10.97

(72) Inventor:

HAKOMORI SHIYUNJI

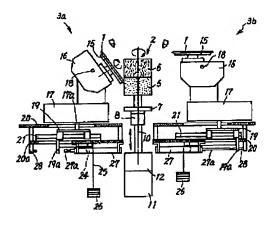
(54) METHOD OF AND DEVICE FOR POLISHING WORK EDGE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polishing means of rough polishing and finish polishing a work edge unwastefully and efficiently.

SOLUTION: A polishing drum 2 having a first work surface 5 for rough polishing with fixed grains carried thereon and a second work surface 6 for finish polishing consisting of a polishing pad to both sides of axial direction is used. After pressing and rough polishing the outer periphery edge of a work 1 held on work holding means 3a, 3b to the first work surface 5 of the polishing drum 2, a finish polishing is carried out while pressing to the second work surface 6.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-104942

(43)公開日 平成11年(1999)4月20日

(51) Int.Cl. ⁸	徽別記号	FI
B 2 4 B 9/00	601	B 2 4 B 9/00 6 0 1 H
H01L 21/304	301	H01L 21/304 301B
	3 2 1	3 2 1 Z

審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 6 頁)

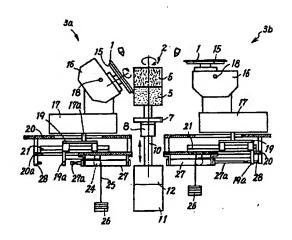
(21)出願番号	特願平9-285988	(71) 出顧人	000107745
			スピードファム株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)10月2日		神奈川県綾瀬市早川2647
		(72)発明者	箱 守 殿 二
			東京都目黒区下目黒4-22-16
		(74)代理人	弁理士 林 宏 (外1名)
		, ,,,,	

(54) 【発明の名称】 ワークエッジの研磨方法及び装置

(57)【要約】

【課題】 ワークエッジの粗研磨と仕上げ研磨とを無駄 なく且つ効率良く行うための研磨手段を得る。

【解決手段】 固定砥粒を担持させた粗研磨用の第1作 業面5と研磨パッドからなる仕上げ研磨用の第2作業面 6とを軸方向の両側に有する研磨ドラム2を使用し、ワ ーク保持手段3 a, 3 bに保持させたワーク1の外周エ ッジを、上記研磨ドラム2の第1作業面5に押し付けて 粗研磨したあと、第2作業面6に押し付けて仕上げ研磨 する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】粗研磨用の第1作業面と仕上げ研磨用の第2作業面とを軸線方向両側に有する研磨ドラムを使用し、この研磨ドラムを軸線の回りに回転させながら、回転するワークの外周エッジを上記第1作業面に接触させて粗研磨したあと、第2作業面に接触させて仕上げ研磨することを特徴とするワークエッジの研磨方法。

【請求項2】請求項1に記載の研磨方法において、上記研磨ドラムを、第1作業面が下に位置し第2作業面が上に位置するよう鉛直に配置することにより、粗研磨を仕 10上げ研磨より下方の位置で行うことを特徴とするもの。 【請求項3】請求項1又は2に記載の研磨方法において、上記研磨ドラム又はワークを、作業面上の接触位置を変えるために研磨ドラムの軸線方向に相対的に移動させることを特徴とするもの。

【請求項4】粗研磨用の第1作業面と仕上げ研磨用の第2作業面とを軸線方向の両側に有する少なくとも1つの研磨ドラム;上記研磨ドラムを軸線の回りで回転させる駆動手段;面取りした外周エッジを有する円板形ワークを保持して回転させると共に、該ワークの外周エッジを20上記研磨ドラムの各作業面に接触させる少なくとも1つのワーク保持手段;ワークの外周エッジを研磨ドラムの第1作業面と第2作業面とに選択的に接触させるため、該研磨ドラム又はワーク保持手段を研磨ドラムの軸線方向に相対的に移動させる移動手段;を有することを特徴とするワークエッジの研磨装置。

【請求項5】請求項4に記載の研磨装置において、上記第1作業面が固定砥粒を担持する部材により形成され、第2作業面が研磨パッドにより形成されていることを特徴とするもの。

【請求項6】請求項5に記載の研磨装置において、上記 研磨ドラムを、第1作業面が下に位置し且つ第2作業面 が上に位置するよう鉛直に配置してあることを特徴とするもの。

【請求項7】請求項4ないし6の何れかに記載の研磨装置において、上記研磨ドラムとワーク保持手段とが、作業面に対するワークの接触位置を変えるために研磨ドラムの軸線方向に相対的に移動自在であることを特徴とするもの。

【請求項8】請求項4ないし7の何れかに記載の研磨装置において、上記ワーク保持手段が、ワークを加工中常に一定の力で作業面に接触させるための付勢手段を有することを特徴とするもの。

【請求項9】請求項4ないし8の何れかに記載の研磨装置において、上記研磨ドラムを挟んで第1及び第2の2つのワーク保持手段が設けられると共に、ワークを表裏反転させるための反転手段が設けられ、上記第1ワーク保持手段が、ワークの表面側エッジを研磨ドラムの第1側において作業面に押し付けて研磨し、第2ワーク保持手段が、ワークの裏面側エッジを研磨ドラムの第2側に50

おいて作業面に押し付けて研磨する構成であるとを特徴とするもの。

【請求項10】請求項9に記載の研磨装置において、2 つの研磨ドラムがワークの直径より小さい間隔をおいて 設けられ、ワークがこれら2つの研磨ドラムに同時に押 し付けられて2点で研磨されるように構成されていることを特徴とするもの。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウエハや磁気ディスク基板のような実質的に円板形をしたワークの外周の、面取り加工されたエッジ部分を研磨するための方法及び装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】例えば、半導体ウエハや磁気ディスク基 板等の外周のエッジ部分は一般に面取り加工されてお り、この面取り加工されたエッジ部分を研磨するため各 種の研磨装置が提案されている。例えば、特開平1-7 1656号公報には、研磨ドラムの外周面に研磨パッド を貼り付け、この研磨パッドにウエハの外周エッジを押 し付けて、遊離砥粒を含んだ研磨剤を供給しながら研磨 するものが開示され、特開平7-171749号公報に は、固定砥粒を担持させた研磨テープを回転ドラムに巻 き付け、この研磨テープにウエハの外周エッジを押し付 けて研磨するものが開示されている。

【0003】ところが、研磨パッドを使用する場合と研磨テープを使用する場合とでは研磨時間や研磨精度等に差があり、例えば、研磨パッドを使用する場合は、研磨時間は若干遅いが面精度は高く、研磨テープを使用する場合は、研磨時間は早いが面精度が低い。このため従来では、生産性を高めるため、上記特開平7-171749号公報に開示されているような装置を使用して研磨テープでエッジを粗研磨したあと、研磨パッドを使用して仕上げ研磨するようにしている例も多い。

【0004】しかしながら、このような従来の方法は、 2種類の異なる研磨装置を使用しなければならないため、非常に多くの無駄があった。例えば、2種類の研磨 装置を設置するための広大なスペースが必要であるとか、各研磨装置にワークの位置決め機構や搬送機構等が 付設されているためそれらの機構が重複するとか、両研 磨装置間でワークを受け渡しするための別の搬送機構も 必要になるといったような点である。

[0005]

30

【発明が解決しようとする課題】本発明の技術的課題 は、ワークエッジの粗研磨と仕上げ研磨とを共通の研磨 手段によって無駄なく効率良く行うことができるように することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明は、粗研磨用の第1作業面と仕上げ研磨用の

第2作業面とを軸方向の両側に有する研磨ドラムを使用し、ワーク保持手段に保持させたワークの外周エッジを、上記研磨ドラムの第1作業面に押し付けて粗研磨したあと、第2作業面に押し付けて仕上げ研磨することを特徴としている。

【0007】こような本発明によれば、従来ではタイプが異なる2種類の研磨装置を使用して行わなければならなかった粗研磨と仕上げ研磨とを、1つの研磨装置を使用して簡単且つ効率よく行うことができ、研磨装置の共通化によって設備的及びスペース的な無駄も省くことが 10できる。

【0008】本発明の具体的な構成態様によれば、上記第1作業面が、研磨テープや砥石のような固定砥粒を担持する部材により形成され、第2作業面が研磨パッドにより形成されている。

【0009】本発明において好ましくは、上記研磨ドラムを、第1作業面が下に第2作業面が上に位置するように鉛直に配置することであり、これにより、粗研磨中に第1作業面から剥離した砥粒が第2作業面に付着するようなことがないため、この剥離砥粒がその後の第2作業 20面による仕上げ研磨に悪影響を及ぼすのことがなく、研磨精度が高めることができる。

【0010】本発明の他の具体的な構成態様によれば、上記研磨ドラムを挟んで2つのワーク保持手段が設けられると共に、ワークを表裏反転させるための反転手段が設けられ、第1ワーク保持手段が、ワークの表面側エッジを研磨ドラムの第1側において作業面に押し付けて研磨し、第2ワーク保持手段が、ワークの裏面側エッジを研磨ドラムの第2側において作業面に押し付けて研磨するように構成されている。

【0011】本発明においては、上記研磨ドラムを2つ設け、ワークをこれら2つの研磨ドラムに同時に押し付けることにより2点で研磨するように構成することこともできる。

[0012]

【発明の実施の形態】図1及び図2は本発明に係る研磨装置の第1実施例を示している。この研磨装置は、ワーク1の外周エッジを研磨するための円筒形の研磨ドラム2と、ワーク1を保持して上記研磨ドラム2の外周の作業面に押し付けるための第1及び第2の2つのワーク保40持手段3a,3bと、ワーク1を表裏反転させるための反転手段4とを備えている。

【0013】上記研磨ドラム2は、軸線方向の両側に粗研磨用の第1作業面5と仕上げ研磨用の第2作業面6とを有するもので、上記第1作業面5を下にし、第2作業面6を上にした状態で基板7上に、軸線を鉛直に向けて回転自在なるように取り付けられ、モータ8に連結されている。このモータ8は回転方向及び回転速度を自由に制御できるものである。

【0014】上記第1作業面5は、固定砥粒を担持する 50

研磨テープ5 a をドラムの外面に巻き掛けることにより 構成され、第2作業面6は、ドラムの外面に貼り付けた 研磨パッドにより構成されている。

【0015】上記研磨テープ5aは、図3からも分かるように、上記研磨ドラム2と、基板7上に回転自在に設置された小径のテンションローラ9とに巻き掛けられ、このテンションローラ9によって必要なテンションが付与された状態で、研磨ドラム2の回転により駆動されてこれらの研磨ドラム2とテンションローラ9との回りを周回するようになっている。

【0016】上記基板7の下面には昇降軸10が取り付けられ、この昇降軸10が移動機構11と揺動機構12とに連結されている。移動機構11は、基板7(従って研磨ドラム2)を上下に移動させることによってワーク1を研磨ドラム2の第1作業面5又は第2作業面6に選択的に接触させるもので、エアシリンダや、ボール螺子とそれに螺合するナット部材等によって構成される。一方揺動機構12は、エッジの研磨時に基板7(従って研磨ドラム2)を上下に揺動させて作業面5,6に対するワーク1の接触位置を変えるためのもので、例えばカムやリンク等の組み合わせによって構成することができる。

【0017】上記ワーク保持手段3a,3bは、図6に示すように面取りされた外周エッジ1a,1bを表裏面に有する円板形ワーク1を保持して軸線Lの回りに回転させながら、その外周エッジ1a,1bを研磨ドラム2の作業面5,6に接触させるためのもので、該研磨ドラム2を挟んで相対する位置に配設されている。研磨ドラム2の第1側に配設された第1ワーク保持手段3aは、ワーク1の表面側のエッジ1aを上記各作業面5,6に押し付けて研磨するものであり、研磨ドラム2の第2側に配設された第2ワーク保持手段3bは、ワーク1の裏面側のエッジ1bを上記各作業面5,6に押し付けて研磨するものである。

【0018】上記2つのワーク保持手段3a,3bは同一構成を有するもので、次のように構成されている。即ち、上記ワーク保持手段3a,3bは、ワーク1をバキュームチャックするためのチャックヘッド15と、該チャックヘッド15を回転自在に保持する第1ボディ16と、該第1ボディ16を支軸18を中心に傾動自在なるように支持する第2ボディ17とを有している。該第2ボディ17はスライド部材19上に脚17aにより取り付けられ、該スライド部材19が、機体20と一体のプレート20a上に設置されたレール21に、研磨ドラム2に接離する方向に直線的に移動自在なるように載置されている。

【0019】上記プレート20aにはプーリ24が取り付けられ、このプーリ24にワイヤ25が巻き掛けられており、このワイヤ25の一端はスライド部材19から下方に延出するアーム19aに固定され、ワイヤ25の

先端にはウエート26が吊り下げられている。また、上 記プレート20aにはエアシリンダ27が取り付けら れ、このエアシリンダ27のロッド27aの先端が上記 アーム17aに当接している。

【0020】従って、上記エアシリンダ27のロッド2 7 a を伸長させると、ワーク保持手段3 a, 3 bは、図 1の右半部に示すように、ウエート26を引き上げなが らレール21上を研磨ドラム2から離れた非研磨位置ま で後退し、ロッド27aを短縮させると、図1の左半部 に示すように、ウエート26の重力によってワーク1が 10 研磨ドラム2に当接する研磨位置まで前進する。 そして ワーク1が研磨ドラム2に当接するとワーク保持手段3 a, 3 bはその位置で停止するが、そのあともロッド2 7 a は僅かに短縮してアーム19 a から離れるため、ワ ーク1がウエート26の重力によって研磨ドラム2に押 し付けられることになる。従って上記ウエート26は、 研磨時にワーク1を研磨ドラム2に一定の圧力で押し付 けるための付勢手段を構成するものである。図中28 は、ワーク保持手段3a、3bの後退位置を規定するた めのストッパである。

【0021】上記チャックヘッド15は、その表面に複 数の吸着穴を有していて、これらの吸着穴が、第1ボデ ィ16及び第2ボディ17に設けられたポートや配管チ ューブ等を介して真空源に接続されているが、それらの 図示は省略されている。

【0022】また、上記第1ボディ16は、図2の右半 部に示すように、ワーク1を研磨ドラム2から離間させ るためにチャックヘッド15が水平を向く非傾斜位置 と、同図の左半部に示すように、ワークエッジを研磨ド ラム2に接触させるためにチャックヘッド15が前傾す る傾斜位置との間を変移する。図中29は、研磨部分に 水又は研磨剤等の研磨液を供給するためのノズルであ

【0023】上記反転手段4は、屈伸自在の多関節アー ム34の先端に、ワーク1をバキュームチャックするた めの反転自在のチャックヘッド35を有するもので、2 つのワーク保持手段3 a, 3 bの間を移動自在なるよう に配設されている。

【0024】上記構成を有する研磨装置において、図示 しないローディング手段により未処理ワークが、非研磨 位置にある第1ワーク保持手段3aのチャックヘッド1 5に供給されると、第1ボディ16が傾斜位置に前傾す る。そして、エアシリンダ27のロッド27aが短縮し て該第1ワーク保持手段3aがレール21上を研磨ドラ ム2の方向に前進し、そのチャックヘッド15に保持さ れて回転するワーク1の表面側のエッジ1 aが、回転す る研磨ドラム2の下部の第1作業面5に押し付けられて 粗研磨される。このときの作業面5に対するワーク1の 接触圧は、ウエート26の重力によって得られる。ま

に、揺動機構12で基板7を研磨ドラム2の軸線方向に 揺動させることにより、第1作業面5に対するワーク1 の接触位置が変えられ、該第1作業面5の偏摩耗が防止 される。

【0025】上記第1作業面5による粗研磨が終了する と、移動機構11により基板7が下降して作業面が変更 され、第2作業面6による仕上げ研磨が行われる。この ときの作業面の変更は、エアシリンダ27により第1ワ ーク保持手段3aを後退させてワーク1を第1作業面5 から一旦離間させ、その状態で上記移動機構11により 該研磨ドラム2を下降させたあと、第1ワーク保持手段 3 a を再び前進させてワーク 1 を第2作業面 6 に接触さ せる方法で行うことが望ましい。また、上記第1作業面 5で粗研磨するときと第2作業面6で仕上げ研磨すると きとで、研磨ドラム2の回転速度を変えることが望まし

【0026】上記第2作業面6による仕上げ研磨が終了 すると、ワーク1の表面側のエッジ1 a の研磨は完了 し、上記第1ワーク保持手段3aがエアシリンダ27に より非研磨位置まで後退すると共に、第1ボディ16が 非傾斜位置に復帰してワーク1を水平に向ける。

【0027】次に、反転手段4が上記第1ワーク保持手 段3aからワーク1を受け取り、それを表裏反転させて 第2ワーク保持手段3bに供給する。それと同時に第1 ワーク保持手段3 a には、上記ローディング手段により 次の未処理ワークが供給される。そして、上述した表面 側エッジ1 a の研磨の場合と同様に、研磨ドラム2の第 2側では、第2ワーク保持手段3bによってワーク1の 裏面側のエッジ1bが第1及び第2作業面5,6により 研磨され、研磨ドラム2の第1側では、第1ワーク保持 手段3aによって新たなワーク1の表面側のエッジ1a が両作業面5,6により研磨される。

【0028】上記研磨が終了すると、第2ワーク保持手 段3 bに保持されて裏面側エッジ1 bの研磨が終わった ワーク1は、図示しないアンローデング手段により取り 出されて次工程に送られ、第1ワーク保持手段3 a で表 面側のエッジ1aが研磨されたワーク1は、反転手段4 で表裏反転されて第2ワーク保持手段3 bに供給され る。上記工程が繰り返されることにより、ワーク1の表 裏両面の外周エッジ1a, 1bが連続工程によって効率 良く研磨される。

【0029】また、1つの研磨ドラム2に粗研磨用の第 1作業面5と仕上げ研磨用の第2作業面6とを形成し、 それらの作業面5,6を選択的に使い分けることによっ て粗研磨と仕上げ研磨の両方を行うようにしているた め、1つの研磨装置を使用してワークエッジを無駄なく 効率よく研磨することができ、従来のように2種類の異 なる研磨装置を使用する必要がないため、設備的及びス ペース的な無駄もなくなる。しかも、固定砥粒を担持さ た、研磨中上記ノズル29から研磨液が供給される。更 50 せた第1作業面5を第2作業面6より下方に位置させて いるため、研磨中に該第1作業面5から剥離した砥粒が 第2作業面6に付着することがなく、この剥離砥粒がそ の後の第2作業面6による仕上げ研磨に悪影響を及ぼす ことがない。

【0030】図4は本発明の第2実施例を示すもので、この第2実施例の研磨装置は、2つの研磨ドラム2,2 を有していて、ワーク1の外周エッジ1a,1bをこれら2つの研磨ドラム2,2の作業面5,5又は6,6に同時に接触させて2点で研磨するように構成したものである。即ち、基板7上に2つの研磨ドラム2,2がワー10ク1の直径より小さい間隔をおいて並設され、2つのワーク保持手段3a,3bが、これら2つの研磨ドラム2,2のちょうど中間に位置するように配設されている。

【0031】上記以外の構成及び作用は実質的に上記第 1実施例と同じであるため、主要な同一構成部分に第1 実施例と同じ符号を付してその説明は省略する。この第 2実施例のように、研磨ドラム2を複数設けてワークエ ッジを複数点で同時に研磨することにより、研磨効率を 高めて研磨時間を大幅に短縮することができる。

【0032】なお、この第2実施例においては、ワーク 1が何れか一方の研磨ドラム2に片当りするのを防止するため、ワーク保持手段3a,3bには、2つの研磨ドラム2,2の中心を結ぶ線と平行な方向の自由度を持たせておくことが望ましい。この自由度を持たせるための手段としては、例えば図5に示すように、スライド部材19の上面にレール21と直交する方向の第2レール31を設け、この第2レール31上に第2スライド部材32を摺動自在に載置して、この第2スライド部材32にワーク保持手段3a,3bの第2ボディ17を取り付け30るようにすれば良い。

【0033】上記研磨ドラム2の各作業面5,6は、ワーク1が若干食い込み得る程度の柔軟性を持っていることが望ましく、これにより、表裏面のエッジ1a,1bを研磨するのと同時に外周面1cも研磨することができる。

【0034】なお、上記実施例では、研磨加工時のワーク1の接触圧を設定する付勢手段をウエート26で構成しているが、このウエート26に代えて、圧力調節手段付きのエアシリンダにより構成しても良い。また、第1作業面5を研磨テープ5aで形成しているが、砥石により形成することもできる。

[0035]

【発明の効果】このように本発明によれば、1つの研磨ドラムに粗研磨用の第1作業面と仕上げ研磨用の第2作業面とを形成し、それらの作業面を選択的に使い分けてワークエッジを研磨するようにしたので、従来ではタイプの異なる2種類の研磨装置を個別に使用して行わなければならなかった粗研磨と仕上げ研磨とを、1つの研磨装置を使用して無駄なく効率よく行うことができ、研磨装置の共通化によって設備的及びスペース的な無駄も省くことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る研磨装置の第1実施例を示す断面 図である。

20 【図2】図1の平面図である。

【図3】第1実施例の要部側面図である。

【図4】本発明に係る研磨装置の第2実施例を示す断面図である。

【図5】第2実施例の要部断面図である。

【図6】ワークの部分側面図である。

【符号の説明】

 1 ワーク
 1 a, 1 b エ

 ッジ
 3 a, 3 b ワ

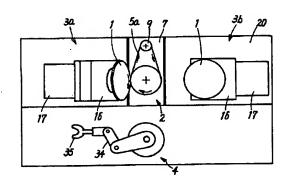
 - ク保持手段
 5 第1作業面

 6 第2作業面
 5 a 研磨テー

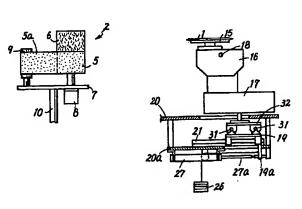
 プ
 1 1 移動機構

26 ウエート(付勢手段)

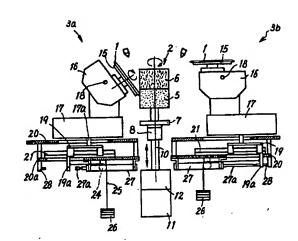
【図2】



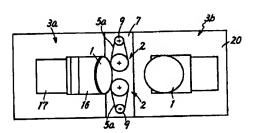
【図3】 【図5】



【図1】



【図4】



【図6】

